

巻頭言	幹事長の 2 年間を振り返って (筑波大/重川秀実)	1
研 究	薄膜界面制御とデバイス応用	
	直接接合 LaAlO ₃ /Si 界面への 1 原子層 SrSi ₂ 挿入による界面特性改善 (東芝/高島 章)	2
	HfSiO _x による仕事関数制御を利用した低コスト 45nm ノード CMOS 技術 (NEC エレクトロニクス/筒井 元)	9
	新しい XPS 評価手法を用いた極薄 SiO ₂ /Si 界面の研究 (宇宙研/廣瀬和之)	14
	強相関スピントンネル接合の界面制御 (産総研/赤穂博司)	19
最新技術情報	キセノンプラズマ発光によるバルク敏感高分解能光電子分光 (東北大/相馬清吾, 佐藤宇史, 高橋 隆)	27
談話室	研究室紹介 (物材機構 原子エレクトロニクスグループ)	34
Brush up English	科学英語一言メモ (3) : “More Is Different” (多は異なり) (筑波大/山下理恵)	36
掲示板		
	研究会概要報告	
	・第 15 回走査型プローブ顕微鏡国際コロキウム (ICSPM15)	37
	・第 8 回「イオンビームによる表面・界面解析」特別研究会	38
	・表面・ナノ科学シンポジウム 2008	39
	・ゲートスタック研究会—材料・プロセス・評価の物理— (第 13 回)	40
	開催案内	
	・第 36 回 薄膜・表面物理セミナー (2008)	41
	・2008 International Workshop on DIELECTRIC THIN FILMS FOR FUTURE ULSI DEVICES : SCIENCE AND TECHNOLOGY (IWDTF-08)	42
	議事録	
	第 36 期第 3 回 幹事会議事録抄録	43
	第 36 期第 4 回 幹事会議事録抄録	44
	第 36 期第 4 回 常任幹事会議事録抄録	45
	第 36 期第 5 回 常任幹事会議事録抄録	46
	第 37-38 期 幹事選挙結果報告	48
会 告	ニュースレター投稿規定	49
	応用物理学会 薄膜・表面物理分科会 第 36 期常任幹事名簿	50
	応用物理学会 薄膜・表面物理分科会 会員数、賛助会社名簿	51
編集後記		52

*分科会会員はホームページ (<http://annex.jsap.or.jp/tfspd/>) からカラー版 PDF ファイルをダウンロードする事ができます (パスワードは“Audrey”です)。

表紙写真：極微細トランジスタの透過電子顕微鏡写真
(筒井氏提供, 詳しくは本誌 10 ページ参照)